PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-153969

(43) Date of publication of application: 08.06.1999

(51)Int.CI.

G09F 9/313 G02F 1/1333 H01J 11/02 H01J 17/20

(21)Application number: 09-335145

(71)Applicant: SONY CORP

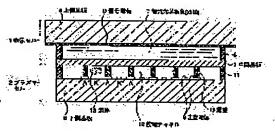
(22)Date of filing:

19.11.1997 AND MICOLOGIA SHINJI

(54) DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the operation speed of a display device using plasma discharge. SOLUTION: A display cell 1 has a top side substrate 4 which is joined to an intermediate substrate 3 through a prescribed gap, an electrooptical material 7 held by the gap, and signal electrodes D which are formed on the substrate 4 in column shapes and are supplied with picture signals. A plasma cell 2 is provided with a bottom side substrate 8 which is joined to the substrate 3 through a prescribed gap and forms a hermetically sealed space, an ionizable gas 13 which fills in the space. and scanning electrodes 9 which are formed on the substrate 8 in row shapes and generate plasma discharge. The electrodes 9 are successively scanned and the picture signals applied to the electrodes D are written into the material 7. The gas 13 for the plasma discharge is the mixture of inert elements such as Kr (krypton) and Xe(xenon) as a main body and hydrogen elements are included. The inert elements transition



from the ground state to an excited state by the start of a discharge, transition from the excited state to the ground state by the suspension of the discharge and remain in a metastable state for a short time. On the other hand, hydrogen elements quickly eliminate the metastable state of the inert elements, accelerate the attenuation of the discharge and the successive scanning of the electrodes 9 is made faster.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-153969

(43)公開日 平成11年(1999)6月8日

(51) Int.CL*		酸別配号		FΙ				
G09F	9/313			G09F	9/313		Z	
G02F	1/1333			G02F	1/1333			
H01J	11/02			H01J	11/02		Α	
	17/20		. ^ _		17/20			
			* **					
				審査請	永積未 农	請求項の数 9	FD	(全 7 百)

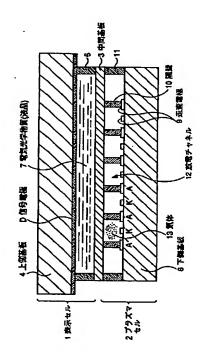
(21)出願番号	特顏平9-335145	(71) 出願人 000002185	
(22) 出願日	平成9年(1997)11月19日	ソニー株式会社 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 (72)発明者 渡辺 伸二 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ 一株式会社内 (74)代理人 弁理士 鈴木 晴敏	=

(54) 【発明の名称】 表示装置

(57)【要約】

【課題】 プラズマ放電を利用した表示装置の高速動作化を図る。

【解決手段】 表示セル1は所定の間隙を介して中間基 板3に接合した上側基板4と、この間隙に保持された電 気光学物質7と、上側基板4に列状に形成され画像信号 が印加される信号電極Dとを有する。プラズマセル2は 所定の間隙を介して中間基板3に接合し密閉された空間 を形成する下側基板8と、この空間に満たされたイオン 化可能な気体13と、下側基板8に行状に形成されプラ ズマ放電を発生する走査電極9とを備えている。走査電 極9を順次走査して信号電極Dに印加された画像信号を 電気光学物質7に書き込む。プラズマ放電用の気体13 はKrやXeなどの不活性元素を主体にして水素元素を 含有した混合物からなる。不活性元素は放電開始により 基底状態から励起状態に遷移し放電停止により励起状態 から基底状態に遷移するとともに、一部が暫時準安定状 態に留まろうとする挙動を示す。これに対し、水索元素 は不活性元素の準安定状態を速やかに消滅させて放電の 減衰を加速し、走査電極9の順次走査を高速化する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の間隙を介して互いに接合し密閉された空間を形成する一対の基板と、該空間に満たされたイオン化可能な気体と、少なくとも片方の基板に形成され該気体をイオン化して該空間に放電を発生する電極とを備えた表示装置において、

前記気体は不活性元素を主体にして水素元素を含有した 混合物からなり、

該不活性元素は放電開始により基底状態から励起状態に 遷移し放電停止により励起状態から基底状態に遷移する とともに、一部が暫時準安定状態に留まろうとする挙動 を示し、

該水素元素は不活性元素の準安定状態を速やかに消滅させて放電の減衰を高速化することを特徴とする表示装 價。

【請求項2】 前記不活性元素はクリプトンまたはキセノンから選択された少なくとも一種を用いることを特徴とする請求項1記載の表示装置。

【請求項3】 前記水素元素は水素ガスとして0.01%ないし20%の濃度で含有されていることを特徴とする請求項1記載の表示装置。

【請求項4】 前記水素ガスの分圧を維持するため該密 閉された空間内に水素吸蔵体を配したことを特徴とする 請求項3記載の表示装置。

【請求項5】 中間基板を介して互いに重なった表示セルとプラズマセルとからなるフラットパネル構造を有

該表示セルは所定の間隙を介して該中間基板に接合した 上側基板と、該間隙に保持された電気光学物質と、該上 側基板に列状に形成され画像信号が印加される信号電極 とを有し、

該プラズマセルは所定の間隙を介して該中間基板に接合 し密閉された空間を形成する下側基板と、該空間に満た されたイオン化可能な気体と、該下側基板に行状に形成 され該気体をイオン化して該空間に放電を発生する走査 電極とを備え、

該走査電極を順次走査して該信号電極に印加された画像 信号を該電気光学物質に書き込む表示装置において、

前記気体は不活性元素を主体にして水素元素を含有した 混合物からなり、

該不活性元素は放電開始により基底状態から励起状態に 遷移し放電停止により励起状態から基底状態に遷移する とともに、一部が暫時準安定状態に留まろうとする挙動 を示し、

該水素元素は不活性元素の準安定状態を速やかに消滅させて放電の減衰を加速し、該走査電極の順次走査を高速 化することを特徴とする表示装置。

【請求項6】 前記不活性元素はクリプトンまたはキセノンから選択された少なくとも一種を用いることを特徴とする請求項5記載の表示装置。

【請求項7】 前記水素元素は水素ガスとして0.01 %ないし20%の濃度で含有されていることを特徴とする請求項5記載の表示装置。

【請求項8】 前記水素ガスの分圧を維持するため該密 閉された空間内に水素吸蔵体を配したことを特徴とする 請求項7記載の表示装置。

【請求項9】 前記互いに隣り合う反対極性の走査電極の関隔をdとすると、該不活性元素の分圧Pは以下の関係を満足することを特徴とする請求項5記載の表示装置

【数1】 0.02≦P・d≦3 [Pa・m] 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はプラズマ放電を利用 した表示装置に関する。詳しくは、表示装置を構成する プラズマセルに充填されるイオン化可能な気体の組成に 関する。

[0002]

【従来の技術】プラズマ放電を利用した表示装置はフラ ットな構造に特徴があり、PDPやPALCが知られて いる。PDPはプラズマ放電を利用して蛍光物質を励起 し表示を行うものである。PALCはプラズマ放電を利 用して液晶などの電気光学物質をアドレシングする方式 であり、例えば特開平4-265931号公報に開示さ れている。このプラズマアドレス表示装置は基本的に、 中間基板を介して互いに重なった表示セルとプラズマセ ルとからなるフラットパネル構造を有する。表示セルは 所定の間隙を介して中間基板に接合した上側基板と、間 隙に保持された液晶などの電気光学物質と、上側基板に 列状に形成され画像信号が印加される信号電極とを有す る。プラズマセルは所定の間隙を介して中間基板に接合 し密閉された空間を形成する下側基板と、空間に満たさ れたイオン化可能な気体と、下側基板に行状に形成され 該気体をイオン化して該空間に放電を発生する走査電極 とを備えている。この走査電極を順次走査して信号電極 に印加された画像信号を電気光学物質に書き込むことに より表示を行う。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】プラズマセルでは互いに降り合う走査電極の間に反対極性の放電電圧を印加して気体をイオン化し、プラズマ放電を発生させる。プラズマセルの線順次走査を高速に行う為には、放電電圧の印加に応答して速やかにプラズマ放電が発生するとともに、放電電圧の解除に応答して速やかにプラズマ放電が減衰消滅しなければならない。従来、イオン化可能な気体としてはヘリウムやネオンなどの不活性ガスが用いられていた。これらのガスは放電電圧の印加/解除に応答して基底状態と励起状態の間を遷移する。しかしながち、これらのガスは基底状態と励起状態との間に準安定状態を有しており、励起状態から基底状態への復帰が一

部準安定状態を経由することで、プラズマ放電の減衰消 滅が遅延するという課題があった。この遅延により線順 次走査を高速化することができない。特に、XGA規格 のパーソナルコンピュータ用モニタやHDTV規格のテ レビジョンモニタにプラズマセルを利用する場合、線順 次走査の高速化が必須であるにも係わらず、上述した準 安定状態に起因するプラズマ放電の減衰が遅いことにより、 歯信号の書き込みが完了しない状態で次の走査電極の動 作が始まるため、充分な書き込みが困難となり表示コン トラストが低下してしまう。また、これにより電気光学 物質に不要なオフセット電位が加わることとなるため、 いわゆる表示画面の焼き付きが生じてしまう。

[0004]

【課題を解決する為の手段】上述した従来の技術の課題 を解決するために以下の手段を講じた。即ち、本発明に 係る表示装置は基本的に、所定の間隙を介して互いに接 合し密閉された空間を形成する一対の基板と、該空間に 満たされたイオン化可能な気体と、少なくとも片方の基 板に形成され該気体をイオン化して該空間に放電を発生 する電極とを備えている。特徴事項として、前記気体は 不活性元素を主体にして水素元素を含有した混合物から なる。該不活性元素は放電開始により基底状態から励起 状態に遷移し放電停止により励起状態から基底状態に遷 移するとともに、一部が暫時準安定状態に留まろうとす る挙動を示す。該水素元素は不活性元素の準安定状態を 速やかに消滅させて放電の減衰を高速化する。好ましく は、前記不活性元素はクリプトンまたはキセノンから選 択された少なくとも一種を用いる。また好ましくは、前 記水素元素は水素ガスとして0.01%ないし20%の 濃度で含有されている。 また好ましくは、前記水素ガス の分圧を維持するため該密閉された空間内に水素吸蔵体 を配する。

【0005】本発明は上述した通常のPDP (プラズマ 表示装置) ばかりでなく、PALC (プラズマアドレス 表示装置)にも適用できる。即ち、本発明に係るプラズ マアドレス表示装置は基本的に、中間基板を介して互い に重なった表示セルとプラズマセルとからなるフラット パネル構造を有する。該表示セルは所定の間隙を介して 該中間基板に接合した上側基板と、該間隙に保持された 電気光学物質と、該上側基板に列状に形成され画像信号 が印加される信号電極とを有する。該プラズマセルは所 定の間隙を介して該中間基板に接合し密閉された空間を 形成する下側基板と、該空間に満たされたイオン化可能 な気体と、該下側基板に行状に形成され該気体をイオン 化して該空間に放電を発生する走査電極とを備えてい る。該走査電極を順次走査して該信号電極に印加された 画像信号を該電気光学物質に書き込む。特徴事項とし て、前記気体は不活性元素を主体にして水素元素を含有 した混合物からなる。該不活性元素は放電開始により基

底状態から励起状態に遷移し放電停止により励起状態から基底状態に遷移するとともに、一部が暂時準安定状態に留まろうとする挙動を示す。これに対し、該水素元素は不活性元素の準安定状態を速やかに消滅させて放電の減衰を加速し、該走査電極の順次走査を高速化する。好ましくは、前記互いに隣り合う反対極性の走査電極の間隔をdとすると、該不活性元素の分圧Pは以下の関係を満足する。

【数2】 0.02≦P·d≦3 [Pa·m]

【0006】本発明によれば、不活性元素を主体にして水素元素を含有した混合ガスをプラズマ放電用の気体に用いている。水素元素を添加することにより、クリプトンやキセノンなどの不活性元素の準安定状態(メタステーブルステート)が速やかに消滅(クエンチング)する。加えて、水素元素は水素ガス(H₂)として添加されるが、水素ガス自体は準安定状態がないためプラズマ放電の減衰(ディケイ)に悪影響を及ぼすことがなく、かつ不要電荷の発生もない。

[0007]

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は本発明に係る表示装置の構成を示す模式的な断面図である。本実施形態はプラズマアドレス型であるが、本発明はこれに限られることはなく、通常のプラズマ表示装置にも適用可能である。図示するように、本プラズマアドレス表示装置は表示を加1とプラズマセル2と両者の間に介在する薄板ガラスなどからなる中間基板3とを積層したフラットパネル構造を有する。表示セル1はガラスなどからなる上側基板4を用いて構成されており、その内側主面には透明導電膜からなる複数本の信号電極Dが列方向に沿って互いに平行に形成されている。上側基板4はガラス板などからなりシール材6を用いて所定の間隙を介し中間基板3に接着されている。間隙内には液晶などの電気光学物質7が封入充填されている。

【0008】一方プラズマセル2はガラス板などからな ・る下側基板8を用いて構成されている。下側基板8の内 側主面上には信号電極Dと直交して行方向に延在する走 査電極9が形成されている。この走査電極9は交互にア ノードA及びカソードKとなりプラズマ放電を発生させ る。アノードAに沿ってその一部と重なるように隔壁1 0が形成されている。隔壁10の頂部は中間基板3に当 接しておりスペーサとしての役割を果たす。下側基板8 はガラスフリット11を用いて中間基板3に接合してい る。両者の間には気密封止された空間が形成される。こ の密閉空間は隔壁10によって区画されており個々に行 状の放電チャネル12を構成する。密閉された空間の内 部にはイオン化可能な放電用の気体13が封入されてい る。図から明らかなように、一本の放電チャネル12は 中央のカソードKと両側のアノードAとからなり、互い に反対極性の放電電圧を印加すると、気体13がイオン

化し、内部がプラズマで満たされる。なお、本発明は図1に示したプラズマセル2の構造に限られるものではなく、例えば隔壁10を下側基板8の上に直接形成し、一対の隔壁10で囲まれた放電チャネル12に互いに平行な一対のアノードA及びカソードKを配するようにしてもよい。

【0009】係る構成を有するプラズマアドレス表示装置では、列状の信号電極Dと行状の放電チャネル12との間に画素が規定される。プラズマ放電が行われる行状の放電チャネル12を線順次で切換走査するとともに、この走査に同期して表示セル1側の列状信号電極Dに画像信号を印加することにより表示駆動が行われる。放電チャネル12内にプラズマが発生すると内部はほぼ一様にアノード電位になり、一行毎の画素選択が行われる。即ち放電チャネル12はサンプリングスイッチとして機能する。プラズマサンプリングスイッチが導通した状態で各画案に画像信号が印加されると、サンプリングが行われ画素の点灯もしくは消灯が制御できる。プラズマサンプリングスイッチが非導通状態になった後にも画像信号はそのまま画素内に保持される。

【0010】特徴事項として、放電用の気体13は不活 性元素を主体にして水素元素を含有した混合物からな る。不活性元素は放電開始により基底状態から励起状態 に遷移し放電停止により励起状態から基底状態に遷移す るとともに、一部が暫時準安定状態に留まろうとする挙 動を示す。これに対し、該水素元素は不活性元素の準安 定状態 (メタステーブルステート) を速やかに消滅(ク エンチング)させて放電の減衰(ディケイ)を加速し、 走査電極9の順次走査を高速化する。好ましくは、不活 性元素はクリプトン (Kr) またはキセノン (Xe) か ら選択された少なくとも一種を用いる。 また好ましく は、水素元素は水素ガス(H_2)として0.01%ない し20%の濃度で含有されている。また好ましくは、水 案ガスの分圧を維持するためプラズマセル2の密閉され た空間内に水素吸蔵体を配する。水素ガスH2 はプラズ マ放電により走査電極9に打ち込まれるなどして経時的 に消失していく。これに対処するため、プラズマセル2 内に水素吸蔵体を配することで、水素吸蔵機構の可逆的 な反応を利用し、安定的に水素ガス濃度を維持していく ことが可能になる。水素吸蔵体としては例えばTi、N i、Zrなどを含有した水素吸蔵合金を用いることがで きる。水素吸蔵合金は走査電極9と一体または別体に配 することができる。また好ましくは、互いに隣り合う反 対極性の走査電極9 (即ち互いに隣り合うアノードA及 びカソードK)の間隔をdとすると、不活性ガスの分圧 Pは以下の関係を満足するように調整されている。

【数3】 0.02≤P·d≤3[Pa·m]

【0011】図2は、各種の気体の準安定準位を示す表図である。気体種として、He, Ne, Ar, Kr, Xe, Hg, N, Oを挙げてあり、準安定準位はeVの単

位で表わしてある。これらの気体は高電圧を印加するこ とで基底状態から励起状態に遷移する。高電圧を解除す ることで励起状態から基底状態に復帰する。励起状態は 一般には極めて不安定であり、10⁻⁸秒以下の大変短い 時間のうちに元の基底状態に帰る。 しかし、励起状態の 中でも大変安定なものがあり、10-4ないし10-2秒の 寿命を持つ。これを準安定状態と称する。準安定状態の エネルギーレベルが図2に示す準安定準位である。イオ ン化した元素はこの準安定状態から直接基底状態に戻れ ず、他の分子、原子又は器壁への衝突による他はない。 準安定状態の存在によりプラズマ放電のディケイが遅延 し、高速走査の障害になる。準安定状態にある粒子は僅 かなエネルギーでイオン化するため、プラズマアドレス 表示装置の画像信号書込動作において、データを消失さ せる働きを持つ。以上の点から、プラズマ放電用の気体 としては可能な限り準安定準位に滞留する時間の短いガ ス種を選ぶことが好ましい。図2に示した各種の不活性 気体に着目すると、He, Ne, Arに比べ、Kr, X e は準安定状態に滞留する時間が短い。そこで、図1に 示した実施形態ではプラズマ放電用の気体として、クリ プトン (Kr) またはキセノン (Xe) から選択された 少なくとも一種の不活性元素を用いている。

【0012】本発明ではプラズマ放電のディケイをさら に短縮化するため、上述した不活性元素に水素元素をH $_2$ の形で添加している。 H_2 によりKr, Xeのメタス テーブルステートが速やかにクエンチングする。一方、 H₂ 自体にはメタステーブルステートがないため、画像 信号の書き込みに悪影響を与える不要電荷の発生がな い。なお、水素ガスは0.01%ないし20%の濃度で 不活性気体に混合することが好ましい。 0.01%以下 では上述したクエンチング作用が顕著にならない。又、 水素ガスの消失に対して余有が無く不安定である。-方、20%を超える濃度ではプラズマ放電の発生自体が 不安定になってしまう。加えて、この濃度以下なら水素 ガス爆発の恐れが無い。また、互いに隣り合う反対極性 のアノードA及びカソードKの間隔をdとし、不活性元 素の分圧をPとすると、P・dの値は0.02(Pa・ m) で3 (Pa・m) 以下であることが好ましい。P・ dの値が3 (Pa・m) を上回ると、放電チャネル12 内におけるプラズマ放電の広がりが不十分となり、放電 状態が不安定になることが実験的に確認されている。ま た、P・dの値がO.O2より下回ると、プラズマ放電 の減衰時間が50μmより長くなってしまうことから実 用に適さなくなる。例えば、倍速NTSC方式の画像を 表示装置に映し出す場合、放電チャネル1ライン分に割 り当てられる走査時間は約30μsである。この走査時 間より長い減衰時間を呈するようでは、1ライン毎に画 像信号を高速で書き込むことは困難である。

【0013】本発明の効果を確認するため、実際にプラ ズマアドレス表示装置のサンプルを作成して動作試験を 行った。その結果を説明する前に、理解を助けるためプ ラズマアドレス表示装置の動作を少し詳しく説明する。 図3は、図1に示したプラズマアドレス表示装置の画素 を2個だけ切り取って示した模式図である。この図にお いては、理解を容易にするために2本の信号電極D1. D2と1本のカソードK1と1本のアノードA1のみが 示されている。個々の画素15は、信号電極D1, D2 と、電気光学物質7と、中間基板3と、放電チャネルと からなる積層構造を有している。放電チャネルはプラズ マ放電中にはほぼ実質的にアノード電位に接続される。 この状態で画案に画像信号を印加すると電気光学物質7 及び中間基板3に電荷が注入される。一方、プラズマ放 電が終了すると放電チャネルが絶縁状態に戻るため浮遊 電位となり、注入された電荷は各画素15に保持され る。いわゆるサンプリングホールド動作が行われてい る。 放電チャネルは個々の画素 15 に設けられた個々の サンプリングスイッチ索子として機能するので模式的に スイッチシンポルSW1を用いて表わされている。一 方、信号電極 (D1, D2) と放電チャネルとの間に挟 持された電気光学物質7及び中間基板3は、サンプリン グキャパシタとして機能する。線順次走査によりサンプ リングスイッチSW1が導通状態となると画像信号がサ ンプリングキャパシタにホルードされ、信号電圧レベル に応じて各画素の点灯あるいは消灯動作が行われる。サ ンプリングスイッチSW1が非導通状態になった後も信 号電圧はサンプリングキャパシタに保持され表示装置の アクティブマトリクス動作が行われる。

【0014】図4は、前述したプラズマアドレス表示装 置に接続される駆動回路の構成を表わしている。図示す るように、駆動回路は信号回路21と走査回路22と制 御回路23とから構成されている。信号回路21には複 数本の信号電極D1ないしDmがパッファを介して接続 されている。一方、走査回路22にはカソードK1ない しKnが同じくバッファを介して接続されている。ま た、アノードA1ないしAnは接地されている。信号回 路21及び走査回路22は制御回路23によって互いに 同期を取るように制御されている。カソードK1ないし Knは走査回路22によって線順次で選択される。例え ば、カソードK1が選択された場合には、隣接するアノ ードA1, A2との間でプラズマ放電が発生し局在的な 放電領域が形成される。この放電領域が行走査単位を構 成する。この行走査単位は放電チャネル12に対応して いる。一方、この線順次走査に同期して各信号電極D1 ないしDmに画像信号がパルス状に印加される。信号電 極D1ないしDmは各々列駆動単位を構成する。 列駆動 単位と行走査単位との交差部に個々の画案15が規定さ れる。

【0015】図5を参照してプラズマアドレス表示装置の動作を説明する。本図は1個の画素に着目した場合における画像信号及び放電電圧の出力タイミングを示した

ものである。放電電圧はタイミングTuで接地電位(0 V) から所定の負電位-Vsに立ち上がる。この結果、 放電チャネル内にプラズマ放電が起こり、放電チャネル 内は荷電粒子で満たされカソードの近傍を除いて接地電・ 位となる。所定の走査期間経過後タイミングTdで放電 **電圧は接地電位に立ち下がる。これにより放電チャネル** 内のプラズマ放電は終了する。しかし、プラズマ放電終 了後も準安定状態に粒子が残存しており、徐々に減少し て最終的に放電チャネル内は高抵抗状態となる。一方、 画像信号は、その立ち上がりタイミングSuが放電電圧 の立ち下がりタイミングTdの直前に設定されており、 立ち下がりタイミングSdは放電電圧の立ち下がりタイ ミングTdより後に設定されている。画像信号のパルス 幅Fpwは例えば10μsないし20μsに設定され る。画像信号の電圧Vpは画素に書き込むべき表示デー タに対応しており、例えば0Vから80Vまで変化す る。ノーマリホワイトモードでは80 Vの画像信号を印 加することにより、画素の透過率は100%(白状態) から0% (黒状態) に変化する。理想的には、放電電圧 の立ち下がりタイミングTdで画像信号の電圧Vpがサ ンプリングされ画索に書き込まれる。しかしながら、実 際にはプラズマ放電の減衰時間があるため、画像信号の 書き込みは瞬時には行われない。画像信号の書き込みを 高速化するためにはプラズマ放電の減衰時間を可能な限 り短縮化することが極めて重要である。少なくとも、放 電電圧の立ち下がりタイミングTdから画像信号の立ち 下がりタイミングSdまでの時間Fpwn以内にサンプ リングが完全に完了することが必要である。

【0016】図6は、本発明に従って作成されたプラズ マアドレス表示装置の動作試験結果を示すグラフであ る。縦軸に透過率 (%) を示し、横軸に経過時間 (μ s)を取ってある。この経過時間は放電電圧の立ち下が りタイミングT dを基準に測定したものである。本サン プルは5インチの対角寸法を有し、プラズマ放電用の気 体として10%のH2を混合したXeを用いている。X eの分圧Pは2666Paである。また、互いに隣り合 うアノードΑとカソードΚの間隔 d は例えば150 μ m である。この場合、P・dの値は約0.4 (Pa・m) となる。放電電圧はVs=470Vであり、この時流れ る放電電流は7mAであった。画像信号としてはVpが 24 VでFpwが無限大(フリー)と、Vpが24 Vで Fpwが20μsと、Vpが80VでFpwが20μs の条件で印加した。図6のグラフから明らかなように、 画像信号は速やかに画案に書き込まれた。画素の透過率 変化のプロファイルはほぼ画像信号のプロファイルと対 応しており、極めて応答性がよい。XeにH2を混合す ることでプラズマ放電の減衰時間が顕著に短縮化されて

【0017】図7は比較例の動作試験結果を示すグラフである。この比較例はプラズマ放電用の気体として10

0%Xeを用いたものであり、その圧力は3333Paに設定してある。画像信号としては、Vpが34VでFp wが無限大と、Vpが80VでFp wが 20μ s と、Vpが36.1VでFp wが 20μ s と、Vpが36.1VでFp wが 20μ s と、Vpが30.5VでEp wが無限大のものを印加して透過率の経時変化を測定した。グラフから明らかなように、透過率の経時変化は画像信号に追従しておらず、特に30V程度の中間調電位を書き込む場合、目標の透過率60%に達するまで20ないし 30μ s を要している。

【0018】図8は本発明に従って作成されたプラズマアドレス表示装置の他のサンプルの動作試験結果を示すグラフである。本サンプルではKrに10%の H_2 を混合した気体を用いている。Krの分圧は2666Paに設定してある。またアノードA/カソードK間の距離はは例えば150 μ mである。従って、P・dの値は0.4(Pa・m)程度になる。放電電圧Vsは400Vであり、この時流れる放電電流は16 μ A程度である。画像信号としてはVpが31VでFpwが無限大、Vpが31VでFpwが10 μ sのものを印加した。グラフから明らかなように、透過率の経時変化は極めて高速であり、画像信号の電圧変化にほぼ完全に追従している。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 所定の間隙を介して互いに接合し密閉された空間を形成 する一対の基板と、この空間に満たされたイオン化可能 な気体と、少なくとも片方の基板に形成され該気体をイ オン化して該空間に放電を発生する電極とを備えた表示 装置において、前記気体は不活性元素を主体にして水素 元素を含有した混合物を用いている。係る構成により、 該不活性元素は放電開始により基底状態から励起状態に 遷移し放電停止により励起状態から基底状態に遷移する とともに、一部が暫時準安定状態に留まろうとする挙動 を示し、該水素元素は不活性元素の準安定状態を速やかに消滅させて放電の減衰を高速化する。プラズマ放電の減衰特性が飛躍的に向上するので、XGA規格やHDT V規格の画像を映し出す場合でもそのコントラストが高くなる。また、付随的な効果として、水素ガスを添加することにより放電が安定化し、異常放電が起き難くなりプラズマセルの寿命が伸びる。プラズマ放電の動作電圧や放電電流の経時変化が少なく、制御が容易になる。放電安定化により画像むらが少なくなる。加えて、消費電力が少なくなりこの分プラズマセルの過熱を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る表示装置の構成を示す断面図である。

【図2】各種気体の準安定準位を示す表図である。

【図3】図1に示した表示装置の動作説明に供する模式 図である。

【図4】図1に示した表示装置の駆動回路構成を示す模式図である。

【図5】図1に示した表示装置の動作説明に供する液形図である。

【図 6】本発明に係る表示装置の透過率特性を示すグラフである。

【図7】比較例に係る表示装置の透過率変化を示すグラフである。

【図8】本発明に係る表示装置の透過率特性を示すグラフである。

【符号の説明】

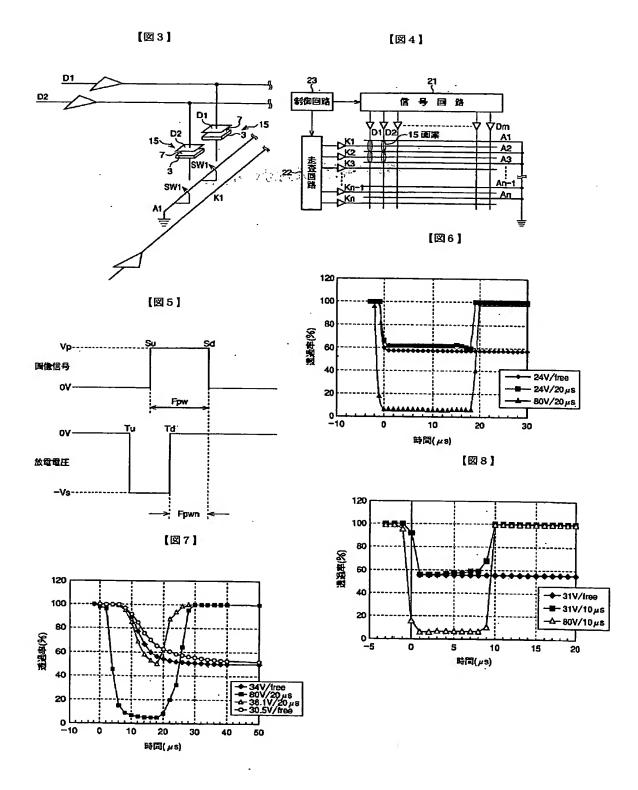
1・・・表示セル、2・・・プラズマセル、3・・中間基板、4・・・上側基板、7・・・電気光学物質、8・・・下側基板、9・・・走査電極、10・・・隔壁、12・・・放電チャネル、13・・・気体、D・・・信号電板

【図1】

【図2】

	4 上個基板	D 信号電視 /	7電気光学物質(液晶) ·	
1 表示セル				
[Ī
2 プラズマ セル				
) 13 5 8 下側基板	\	10 隔壁 9 走査電 極 放電チャネル	

気体	準安定準位(eV)
He	20.9
Ne	16.7
Ar	11.7
Kr	10.5
Χə	9.4
ΖŒ	5.5
	· 3.6
0	4.2



THIS PAGE BLANK (USPTO)